

電子線・光リソグラフィ技術

産業技術総合研究所、東京科学大学、物質・材料研究機構、北海道大学は、2021年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)」の一環として、『電子線・光リソグラフィ技術』と題して技術セミナーを2025年2月25日(水)にハイブリッド開催いたします。マスクレスリソグラフィ技術の解説に加え、フォトマスクを用いてナノメートルスケール描画を実現するリソグラフィ技術、各機関の共用施設のリソグラフィに関わる事例等を紹介いたします。産官いずれのご所属の方々の奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演

【日時】2026年2月25日(水)12:55～16:40

【オンライン会場】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【オンライン】Microsoft Teamsによるウェビナー配信（参加申込者へ別途URLをお送りいたします。）

【定員】オンライン:80名、オンライン:200名（先着順、参加登録をお願いします）

【セミナー案内/申し込み】<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2025-2/>

【参加費】無料

【連絡先メールアドレス】tia-npf-school2@aist.go.jp

◇講演プログラム

12:55-13:00 はじめに

産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設(NPF)

松本 壮平

13:00-13:05 ARIMデータ共用サービスの紹介

物質・材料研究機構 桑田 武

13:05-13:45 「Phable」シリーズによるタルボ効果を応用した周期的ナノパターン露光

(株)協同インターナショナル 一條 智義

13:45-14:25 ハイデルベルグ社製マスクレス露光装置の最新情報

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 池内 真次

14:25-15:05 マスクレス露光装置DLシリーズとその応用例

株式会社ナノシステムソリューションズ 杉村 忍

15:05-15:20 休憩

15:20-15:40 回折格子作製に向けた電子ビームグレースケール露光

東京科学大工学院 前川 永遠

15:40-16:00 電子線リソグラフィにおける描画データから考える解像性・速度の向上

物質・材料研究機構 微細加工ユニット 大里 啓孝

16:00-16:20 BODEN50における実用的なスループットと解像性のビーム電流依存

産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設 木塚 優子

16:20-16:40 描画結果の評価手法について(仮)

北海道大学 松尾 保孝

主催:産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)

共催:物質・材料研究機構微細加工ユニット

共催:東京科学大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

共催:北海道大学北海道大学電子科学研究所